## Growth mechanism of oxide barriers on plasma and ion-beam treated polymer substrates

윤정흠\*, 이성훈, 정유정, 이건환 \*한국기계연구원부설 재료연구소 융합공정연구부 (E-mail: jungheum@kims.re.kr)

초록: 알루미나와 실리카로 대표되는 투명 산화물 박막은 폴리머 기판상의 투습 방지막으로 응용되고 있으며, 플라즈 마와 이온빔을 이용한 폴리머 기판 전처리를 통해 산화물 박막의 투습 특성을 향상시켰다. 기상 증착된 산화물 박막의 성장 거동에 대한 전처리 후 폴리머 기판의 wettability와 morphology의 효과를 확인하였으며, 그 폴리머 기판상에 증착되는 산화물 박막의 성장 메카니즘을 제안하였다.

# 1.서론

연성 폴리머 기판상에 증착된 투명 산화물 박막들은 투습과 투산소를 억제하는 보호막으로 고려되고 있다. 연성 디스플레이와 태양전지로의 응용을 위해서는 이들 보호막에  $10^{-3} \sim 10^{-4}$  g/m²/day의 투습율이 요구된다. 하지만, 기존의 plasma-enhanced chemical vapor deposition (CVD)이나 sputtering 공정으로부터 증착된 산화물 보호막으로는 이러한 낮은 투습율에 도달하기 어려운 것으로 알려져 있다. 보호막의 투습율은 막내에 존재하는 마이크로 pinhole들과 crack들에 의해 결정되며, 이러한 결점들의 생성은 증착전 폴리머 기판의 표면 상태에 의해 심각하게 영향을 받는 것으로 이해되고 있다. 본 연구에서는 ion-beam으로 전처리된 polyethylene terepthalate (PET) 기판의 표면 특성과 그 PET 기판에 sputtering 과 PECVD를 이용하여 중착된  $Al_2O_3/SiO_X$  적흥 보호막의 투습율간의 상관 관계를 고찰하였다.

#### 2.본론

본 연구에서 Ar ion beam을 이용한 PET 기판의 전처리는 Table 1에서 서술된 조건에서 진행되었다.  $Al_2O_3$ 와  $SiO_x$  박 막들은 각각 rf-magnetron reactive sputtering과 rf-PECVD를 이용하여 전처리된 PET 기판상에 증착되었다 [1].

Table 1. Process parameters

Table 1. 1 locess parameters			
	공정변수	실험범위	단위
	dc power	200-280	W
	Ar flow rate	45	sccm
	working pressure	3	mTorr
	time	< 9	min

그림 1(a)와 1(b)에 나타난 것과 같이 PET 기판 표면 morphology와 wettability는 Ar ion beam을 이용한 전처리를 통해 현저히 향상되는 것으로 확인되었다. 전처리된 PET 기판상에 20 nm 두께의 sputtered  $20 \text{ Al}_2 = 20 \text{ Al}_2 = 20 \text{ M}_2 = 20 \text{ M$ 

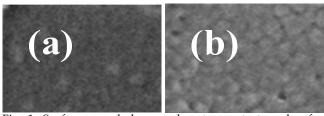


Fig. 1. Surface morphology and water contact angle of ion-beam (a) untreated PET and (b) 3min ion-beam treated PET.

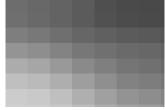


Fig. 2. PET surface damaged by extended

## 3.결론

Ar ion beam을 이용한 PET 기판의 전처리 공정은 이후 증착되는 산화물 보호막의 특성에 지대한 영향을 미치는 것을 확인하였다. 이러한 전처리를 통해 PET 기판의 surface morphology와 wettability가 현저히 향상되어질 수 있었으며, 이러한 표면 특성을 가지는 PET 기판상에 증착된  $Al_2O_3/SiO_x$  보호막으로부터  $10^{-3}$  g/m2/day 이하의 높은 투습방지효과를 확보하였다.

## 참고문헌

1. Jungheum Yun, Sunghun Lee, Yujeong Jeong, Hong-Rim Lee, Jung-Dae Kwon, and Gun-Hwan Lee, Jap. J. Appl. Phys. 48 (2009) 055503.